PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 61104790 A

(43) Date of publication of application: 23 . 05 . 86

(51) Int. CI

C12N 15/00 // C12P 13/22 (C12N 15/00

C12R 1:19 , C12R 1:125)

(21) Application number: 59225915

(22) Date of filing: 29 . 10 . 84

(71) Applicant:

SHOWA DENKO KK

(72) Inventor:

SAKIMOTO KAZUNORI TAKAMATSU HISAO TAKINISHI EIKO NAKAYAMA AKIRA YAJIMA YOSHIHIRO

(54) NOVEL RECOMBINANT DNA HAVING GENETIC INFORMATION PARTICIPATING IN BIOSYNTHESIS OF L-TRYPTOPHAN

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a recombinant DNA capable of creating a transformed strain capable of producing L-tryptophan in high productivity, and obtained by the recombination of an Escherichia coli plasmid vector which can be expressed even in Bacillus subtilis and an L-tryptophan biosynthesis gene DNA fragment.

CONSTITUTION: The phage DNA obtained from the plasmid pTP4 having a chloramphenicol-resistant gene is incised with a restriction enzyme EcoRI (A) to obtain a fragment (B). Separately, a plasmid pBR322 DNA is

incised with the component A to obtain a fragment (C). The fragments B and C are mixed together at an equal concentration of the terminal groups of the fragment, and linked by using T4 phage ligase. A CaCl₂-treated Escherichia coli is transformed with the DNA prepared by the above process. The plasmid pSD3165 is separated and purified from the bacterial cell, and is incised with the component A to obtain a fragment (D). Separately, a phage ϕ105 DNA containing tryptophan operon originated from Bacillus subtilis is incised with the component A to obtain a fragment (E). The fragments D and E are mixed together, and linked with T4 phage ligase.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出題公開

@公開特許公報(A)

昭61 - 104790

@Int.Cl. C 12 N 15/00

广内整理香号 識別記号

❷公開 昭和61年(1986)5月23日

7115-4B×

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

Lートリプトファンの生合成に関与する遺伝情報を有する新規組換 ⊗発明の名称 え体DNA

图 昭59-225915 印特 昭59(1984)10月29日 の田

和範 元 砂発 明

久 雄 松 伊発

英 光 明者 60発

昭和電工株式会社 ①出 顋 人 弁理士 菊地 精一 20代 理 人 最終頁に続く

東京都大田区多摩川2丁目24番25号 昭和電工株式会社生

化学研究所内 東京都大田区多摩川2丁目24番25号 昭和電工株式会社生

東京都大田区多摩川2丁目24番25号 昭和電工株式会社生

化学研究所内 東京都港区芝大門1丁目13番9号

1.発明の名称

トリプトファンの生合成に関与する遺伝 情報を有する新規組換え体 DNA

2. 特許請求の範囲

枯草菌内でも発現し得るクロラム ニル耐性遺伝子を有する大腸菌プラスミドベクタ ≟ pSD 3.1 6 5 •

2. L-トリプトファンの生合成に関与する遠 伝情報を有する DNA 断片と、大腸歯プラスミド pBR 3 2 5 又は大腸菌プラスミド pSD 3 1 6 5 との組 换允体 DNA pSD 2961 又比 pSDT 1111。

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明はパナルス異から選ばれた恵を復主細胞 として形質転換を行なわせしめる組換之体 DNA と して有用な新規大腸関組換えプラスミドに関し、 更に詳しくは、パチルス質に属する宿主菌に、ト リプトファンの生仓成に関与する遺伝子を含む DNA 断寸とペクター DNA との組換之体 DNA を用い 鉄宿主菌内で自己複製させることなく、つまり宿 主言の染色体内には組換え体 DNA を安定に挿入せ しめて、レートリプトファンの高生産性形質転換 匿を創製出来る新規組換之体 DNA に関する。 (従来技術)

発酵法によるレートリプトファンの製造はその 経済性の観点から注目を集め、その際特に、その 基礎となるレートリアトファン生産圏の改良は重 長な課題となっている。

従来、菌の改良には公知の方法、例えば特殊昭 59-130181 号公報に見られるように、主に人工央 然変異法が用いられ、取得した突然変異株によっ てレートリプトファンの製造が行なわれて来た。 しかし、L-トリプトファンの収量は商業的化必 プレも充分なものとは言い難く、その母族的製法 の追求が望されている。そとで、最近開発された 遺伝子組換え技術を利用してアミノ限を高度に生 産するように微生物を処理力ることが出来るよう に種々の研究が行われている。

ととろで、遺伝子組換え技術による思の改良は、

先才遺伝子をその供与細胞から取出し、試験管内 。 でペクメー DNA と前合させ、待られた組換え体 DNA を捜主網題に取り込ませる。そして、目的と 』 する組換え体 DNA を有する商主網胞を増殖せしめ、 次いで導入遺伝子を発現せしめることによって自 的の強物を得る。しかし、これら従来の一数的な 方法によって用いられて来た組換え体 DNA は宿主 細胞内で一般に不安定で培養中に消失したり、も るいは、組換え体の一部が欠失を生ずることがあ る。それゆえ、宿主細胞内にかける組換え体 DNA: の安定化手法が確立されない限り実用性に制約を 受ける。そとで、本発明者等は宿主協内で自己複 製能力を有さない超換え体 DNA を宿主細胞の染色 体に挿入(インテグレーション)することが出来 れ 、安定に組換え体 DNA が宿主細胞に保持され、 上記制約から逃れられることが期待されると考え た。しかしながら、宿主菌内で自己複製能力を有 ・さたい組換え体 DNA を宿主菌の染色体に挿入せし め、得られる形質転換菌を用いて、L-トリプト ファンなどの製造のために供したという何はない。

え体 DNA を用いてトリプトファンアナログ耐性を有する宿主菌を形質転換させた所、親株と比較して、何えばトリプトファン生合成に関係する酵素 活位が高くなった菌株を選択することが出来る。

このように選択された形質転換菌は、レートリプラッンの生産性が高く、更に、例えば一般に知られている自己複製能のある組換え体 DNA、例えば、プラスミドやファーツを用いた場合のような特別な配慮やその不安定さに伴う障害を克服するための対策を講ずることなしに培養が可能であるなど、工業的に有利にレートリプトファンの製造に供することができる。

本発明によれば、レートリプトファンの生合成に関与する遺伝子(質ましくは、トリプトファン あるいはトリプトファンアナログなどによる阻害が解除されているものが望ましい。)を有する DNA 断片とベクター DNA との、 宿主圏内で自己複数 説のないが染色体に安定に挿入される組換え体 DNA が取得出来、これを用いることによってパテルス異に異する優生物から選ばれる宿主選条(好

そこで、レートリプトファンの発酵法による製造のために、レートリプトファンの生合成に関与する遺伝子を新たに宿主菌の染色体に挿入させるべく製意研究を行った所、レートリプトファンの生合成に関与する遺伝子を有する染色体に積した。なりメー DNA を取得することに成功した。は組換え体 DNA を取得することに成功した。は組換

ましくは、トリプトファンアナログ耐性を有する 宿主書)を形質転換出来る。形質転換菌にはその 製色体に該組換え体 DNA が新沈 に挿入されており、 とりして、レートリプトファンの生合成を調整す る遺伝子が新たに付加された染色体 DNA を有する レートリプトファン高生素性層が提供でき、さら に鉄形質転換菌を用いたレートリプトファンの程 時的な発酵法による製造法が提供される。

以下、本発明について更に説明する。 組換え体 DNA の作製

従来、宿主恵を形質転換せしめる場合には、もっぱら宿主恵内で自己複製能力を有する組換え体 DNA、例えば、プラスミドやファージが用いられて来た。しかし、本発明では、染色体に安定に組換え体 DNA を挿入せしめるために、自己複製能力を有さない組換え体 DNA を使用した。

本発明に於けるL-トリプトファンの生合成に 関与する遺伝情報を有する DNA 断片は、 通常L-トリプトファン生産能を有する微生物の 染色体 DNAより適当な制限酵素によって切出されたもの

が用いられるが、宿主唐の衆色体 DNA との相同性 が高いものであれば展別としてその由来について 」は特別な創限はなく、例えば、土壌や他の天然物 から分離されるし・トリプトファン生産能を有す る野生株は勿論のとと、それらを常外線原射や化 学物質による処理をして得られる人工的突然変異 株式いは遺伝子組換え技術を用いて得られるL‐ トリプトファンの生会成に関与する遺伝情報を含 ひ組換え DNA 等いずれても良い。尚、この場合、 は DNA 断片は L - トリプトファンの生合成に関与 する遺伝情報を有する部分のみからなり、他に余 分左部分を含まないものであることが望ましいが、 用いる創限酵素の種類によってはその前後に若干 他へ部分を含むことがあり、そのようなものであ っても宿主菌との相同性や目的とするレットリプ トファンの生合成に悪影響を及ぼさない限り用い ることができる。また、鉄 DNA 断片はL-トリプ トファンの生合成に関与する遺伝情報のすべてを 有する必要はなく、その一部分のみを含んでいる DNA ても用いることがてきる。

pACYC184 , pBR322 , pAT153 , MUA-3 , pCR1 . pKT287 , pKN402 , pBR325 , pBR328 , pBR327 , pNO1523 . pKB111 . pKK223-3 . pKC30 などの大腸 茵 由来のプラスミド及びその誘導体があげられるが、 所謂宿主 - ベクター系として成り立つものであれ は、 勝窩系にとだわる必要はない。 特に、本発明 のすぐれた点は、例えばパチルス異に異さない宿 主細胞、例えば大腸菌などでクローニング出来れ は、その系で用いた組換之体 DNA そのものを直接 本発明に使用出来る点にある。その際、従来技術 であれば、宿主曹以外でクローニングした時、ペ クターとして宿主選内でも自己複製可能なベクタ - (例えば宿主菌内で複製可能なシャトルペクタ - とか広宿主領域ペクターなど)を使用しておく か、あるいはクローニングした DNA を存主菌内で 安定に存在し得るペクターと連結させ直寸操作な どの配慮を必要とした。

以下に代表的な例として大腸菌由来のプラスミド pBR322 及び pBR325 を使用した例を示し、更に具体的に群选するが、前述の如く他の例について

また、これら DNA よりトリプトファン生合成に関与する遺伝子を切出すのに用いられる制限酵素としては特に制限はないが、トリプトファンの生合成に関与する遺伝子中にも切断部位が少ないほうが望ましく、例えば、 EcoR I、 BamH I、 Sa: I、Sac I、 Pvu I、 Xbo I、 Xba I、 Mbo I、 MIu I 等があげられる。

本発明にかいて、宿主舊内で自己複製しないペ クォーとしては、例えば、 CelE1 , pSC101 , pJB8 .

も同様に行い待るととは言うはでもない。

アラスミドpTP4の有するクロラムフェニコール 耐性遺伝子を常法によりファージ p11 の DNA にクローニングし、次いで放ファージ DNA を 制限 学業 EcoR 1 で切断して、予め EcoR 1 で切断していた プラスミド pBR322 DNA と、それら生じた DNA 断片 の末端の数が同じになるよう な濃度で混合し、 T 4 ファージリガーセを用いて結合反応を起こさ

せる。この DNA を用い、塩化カルシウム処理した 大腸菌 C 600 trp、 leu、 thr、 rk mk 株を常法 により形質転換し、クロラムフェニコール、アン ピシリン、テトラサイクリン のいずれにも 耐性を 有する株を取得した。これら形質転換株か らプラ スミドを分離精製し、制限酵素地図をつてくった所、 第1 図のような制限酵素地図を有するプラスミド

第1回のような制限酵素地図を有するプラスミドを含む形質転換散大陽南 SD-1007 (碌工研 国等第7860号)が得られた。 放形質転換菌のプラスミド (pSD3165 と称する)

には pBR322 の EcoR | の切断点に約2.5 ノガブルト ンのクロラムフェニコール耐性遺伝子が挿入られ

ていた。尚、pTP4由来のクロラムフェニコール耐 ・性遺伝子はパテルス・ポプテルス、パテルス・ア ミロリクィファシエンスなどで発現可能であり、 さらに上記の如くクローニングした数クロラムフェニコール耐性遺伝子に関してもパテルス・アデーリクィファシエンス などのパテルス。アデロリクィファシスなどのパテルス属に属する箇内で発現するととは 後に記述するように明らかである。

次に pSD3165 を制限 ps (EcoR I) で部分的に 切断し、またクローンしたトリプトファンエペロンを含 がファージ ∮ 105 DNA(特開昭 59-125892 号参照) も制限 ps (EcoR I) で切断し、両者 DNA を混合 し、T 4 ファージリガーゼを用いて結合させる。 と JNA を用い、塩化カルシウム処理した大陽百 C 600 trp、 lou、 thr、 rk 、 mk 一株を常法に より形質転換し、クロラムフェニコール耐性、アンピシリン耐性及びテトラサイクリン耐性でかつ Trp 非要求性を示す形質転換菌を取得する。

放形質転換菌から組換えプラスミドを常法によ

報を含むファージ # 1 0 5 DNA も EcoR l にて切断し、 開者の DNA を適当な農産で混合し、両 DNA 断片を T 4 ファージリガーゼで結合させる。次に、との DNA を用い、大腸菌 C 6 0 0 trp、 lou、 thr、 rk 、 mk なと上述の方法で形質転換せしめた。 チース・アンピンリン耐性、テトラサイクリン 耐性かつクロラムフェニコール耐性でなかかつ Trp 非要求性の形質転換菌 <u>大腸菌 SD-1009</u> (数工 研賞等第 7 8 6 2 号)を選択した。 故菌よりプラス ミドを常法により分離精製した所、第 3 図に示す ようなプラスミド(pSD2961) が得られた。

尚、数プラスミドを用いて、パテルス・メアチルス bis B 株を形質転換した所、His 非要求性株が得られることから、数組換え体 DNA はトリプトファンオペロン以外に bis B 遺伝子も含むことが利る。

以下に本発明によって得られた超換え体 DNA を用いて、レートリプトファンの高生産性を示す形質転換菌取得の代表的な実施例を示すが、本発明の範囲をこれら実施例に限定するものでないこと

次いでpBR325を用いた例を示す。

プラスミド pBR325 を制限算業 (例えば、EcoRI) で切断し、また例えば、特開昭 59-125892 号で示された方法でクローンしたパテルス・アミロリク 4 ファシエンス IAM1521 (東京大学応用数生物研究所より入手)の5-フルオロトリプトファン射性株のトリプトファンの生合成を調整する遺伝情

はいりまでもない。

宿主国としては前述したような<u>組換え体 DNA を</u> <u>その染色体内に挿入し得るもの</u> ならばいずれても よい。 ごこでは、代表的な例としてパチルス・ズ プテルス IMA1026 株(東京大学応用微生物研究所 より入手)ならびにパチルス・アミロリクィファ シエンス IMA1521 株とそのトリプトファンアナロ グ耐性株、パチルス SD-30 (特開昭 59-130181号) を宿主菌として例示する。

但し、ペナルス SD-30 以外はトリプトファン・アナログである5 - フルオロトリプトファン(以下、5-FTと略ナ)感受性であったので、例えば、N-ノテル・N'-ニトロ・N-ニトロックアニッン等を用いて常法により人工突然変異処理をして、5-FT耐性菌を取得して、以下の実験に供した。また、IMA1521 株に関しては、同様の突然変異処理である。FT耐性を有すヒスナッン要求体を取得し、実験に供した。

英地例1

pSDT1111 0.1~1 #8を上記 値主数に公知の方法

(例えば J.Bacteriol、31、741(1961) 又は Molec. gen. Gent.、168、111(1979) など) によって取り込ませ、形質転換を行ったとこ天 でクロラムフェニコール(10με/㎡)を含む寒 坊 で成育する、いわゆるクロラムフェニコール 能性を有する形質転換菌パテルス 8D-1002 (徹 新 帯 す 855号) が取得できた。この菌の菌学的性質は原株パテルス・アミロリクィファンエントラニル酸によるレートリプトファンの合成のエントリアトファンで対性及びトリプトファンで含成系酵素の活性の点で相違する以外は原株と実質的に同じである。

ところで、トリプトファン合成を調整する遺伝子。含まない、つまり染色体 DNA と相同性がある DNA を含まない pSD3165 そのものを用いた時には、クロラムフェニコール耐性菌の出現は認められなく主菌内で自己複製能力はないと考えられた。さらに、上記形質転換菌からは閉環状 DNA(プラスミド)の存在は認められなかった。このことから、

恵 株

レートリプトファン苦税 (μg/ml)

パナルス SD-30

3 4

パチルス SD-1002

7 :

以上より、pSDT1111が宿主菌染色体に挿入され その結果 pSDT1111由来のトリプトファン生合成系 遠二子が新たに染色体上に付加されトリプトファ ン生合成系遺伝子が増巾されたと解釈できる。

実施例 2

宿主菌として IMA1026 株の 5-FT耐性株を用いた場合も、 同様にして pSDT1111 DNA によって、クロラムフェニコール耐性を有し、 レートリプトファンシンセターゼ活性ならびにその蓄積が約 2 倍
尤進した形質転換株が取得できた。

突施例3

IAM1521 の5-PT耐性を有するヒステジン要求株を宿主菌として、 pSD2961 を供与体 DNA として上述の方法により形質転換し、ヒステジン非要求性菌を選択する。

この場合には宿主菌のヒスナッン遺伝子と

pSDT1111が宿主関発色体に挿入されたと考えられる (参照 Proc. Natl. Acad. Sel. USA. 、 75 3664 (1978))。

次に、パチルス SD-30 株を智主菌に用いて適抜した故形質転換菌のL-トリプトファンシャセターセの活性の測定 [文献 Methods in Ensymology 5、794(1962)] 結果を示す。

画 株

L-トリプトファンシンセ タービ 比 活 住

パチルス SD-30

100.

ペチルス SD-1002

テンの菩及結果を示す。

203

また、放形質転換株のアントラール機(-80-ppm) 存在下にかけるスピザイセン機少培地 [(NH₄)₂SO₄ 0.2 %、K₂HPO₄ 1.4 %、 KH₂PO₄ 0.6 %、クエン酸ナトリウム・2H₂O 0.1 %、 MgSO₄・7H₂O 0.0 2 %、グルコース 0.5 % 〕 で3 7 で、1.5 時間培養した時のレートリプトフ

pSD2961 が有するヒステッツ 遺伝子とが 組換えを 起こしてヒステッツ非要求性となった形質 転換菌 又は上述したように pSD2961 が染色体に 挿入され た結果ヒステッツ非要求性となった形質 転換菌 るいは両反応が同時に起ったヒステッツ 非要求性 形質転換菌の存在が考えられる。

しかし、もし数色体に pSD2961 が挿入された場合にはトリプトファンの合成を調整する遠伝子は 数色体上に少くとも 2 個存在することに なり、例 えばトリプトファンシンセターせ活性が 宿主菌よ り高い事が期待される。

実際、頻度は少いが L - トリプトファンンセターゼ活性の高い形質転換器 パチルス SD-1005 (数工研算等第 7 8 5 8 号、との画学的性質は原体パテルス・アミロリクィファンエンス IAM1 5 21 株とアントラニル酸による L - トリプトファンの合成阻害、5-FT 耐性及びトリプトファン合成系第素の活性の点で相違する以外は原株と変質的に同じである。)が以下に示すように基次できた。

ルートリプトファン シンセターセ比活性

IAM1521 5FT 耐性ヒステジン要求株

1 0 0

パチルス SD-1005

178

以上例示したように、抗生物質耐性途伝子を有した組換え体 DNA を用いたり、 L - トリプトファンの生合成に直接関与する途伝情報以外に他の途伝子を含む組換え体 DNA を用いたり、栄養要求性変異株を復主菌として用いたが、これらは染色体に挿入した組換え体 DNA を含む形質転換菌の取得を容易にさせるもので、単に例示に過ぎない。

抗生物質耐性遺伝子であれば、上配理由から宿主細胞内で発現しうるものならいずれでもよく、マ、宿主官の突然変異も挿入される DNA と相同性 ・持つ選択可能な遺伝子変異ならいずれでもよい ことは明白である。

4.図面の簡単な説明

第1回は p8D3165 の制限酵素地図、

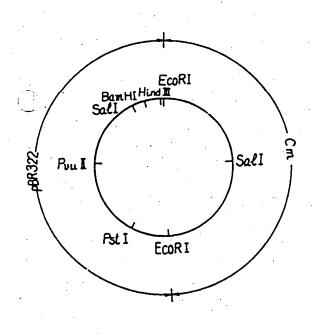
第2回は p8DT1111の制限酵素地図、

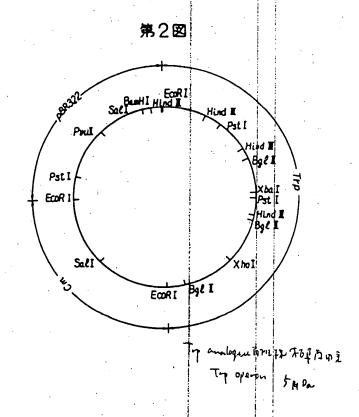
第3回は pSD2961 の制限 酵素地図、 をそれぞれ示す。

pBR322、pBR325 は大勝 国由来プラスミド、Cm はクロラムフェニコール耐性形質を示す 領域、 Trp はトリプトファンの生成号を調整する領域、 Sall、 EcoRl、 Hind 型、 Hine E、 BamH 、 Patl、 Pvu E、 Xbal、 Bgl E、 Xhel、 は制限 原業名であ り、各庫素による切断部位を示す。

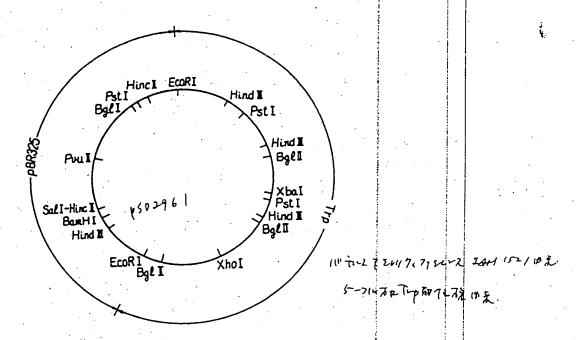
特許出版人 昭和電工株式会社

第1図





第3図



第1頁の統き

砂発 明 者 中 山 明 東京都大田区多摩川2丁目24番25号 昭和電工株式会社生 化学研究所内